

事例講演 4

FOCUSスパコンを利用したスピン洗浄装置の気流解析

山崎 修

芝浦メカトロニクス株式会社 技術本部 研究開発グループ 解析グループ 主査

講演概要

半導体デバイスの製造で使用されるスピン洗浄装置の設計ポイントの 1 つとして、ウエハへのミスト付着防止があげられる。この対策の検討には流体解析の利用が有効である。従来はこのような解析には膨大な時間を要していたが、FOCUS スパコン適用後は大幅な改善に繋がった。講演ではスピン洗浄装置の開発に流体解析を適用した事例について述べるとともに、FOCUS スパコンを適用した場合の計算速度向上率を使用したモデルごとに示す。